

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202945484 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220666513. 2

(22) 申请日 2012. 12. 06

(73) 专利权人 安安(中国)有限公司

地址 363900 福建省漳州市长泰经济开发区
兴泰工业园

(72) 发明人 林天送 顾宇霆 朱国勤

(51) Int. Cl.

D06N 3/14(2006. 01)

B32B 27/12(2006. 01)

B32B 33/00(2006. 01)

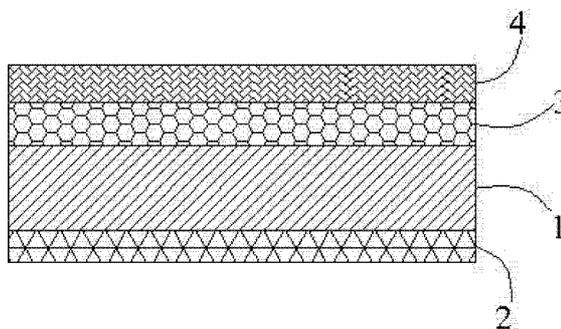
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型超纤合成革

(57) 摘要

本实用新型公开一种新型超纤合成革,其特征在于:包括超纤皮革基层,该超纤皮革基层底面涂覆有一拒水层,且超纤皮革基层上表面则由下至上依次涂覆有湿法PU涂层及干法PU涂层。对超纤皮革基层的底面用辊印的方法涂覆一层拔水剂溶液,再加以烘干形成拒水层;然后在超纤皮革基层的上表面用湿法工艺形成特殊聚氨酯树脂涂层,通过上述方式其可直接做各种后处理压花,解决了压花纹路不良问题,在做干法镜面时,所增加的平整湿法涂层,改善了原有超纤做镜面产品时易出现的表面不平整和折痕大的问题。



1. 一种新型超纤合成革,其特征在于:包括超纤皮革基层,该超纤皮革基层底面涂覆有一拒水层,且超纤皮革基层上表面则由下至上依次涂覆有湿法 PU 涂层及干法 PU 涂层。

一种新型超纤合成革

技术领域

[0001] 本实用新型涉及合成革,尤其是指一种新型超纤合成革。

背景技术

[0002] 超细纤维巨大表面积和强烈的吸水性使得超细级 PU 合成革具有了束状超细胶原纤维的天然革所固有的吸湿特性,因而不论从内部微观结构,还是外观质感及物理特性和人们穿着舒适性等方面,都能与高级天然皮革相媲美了,耐化学性、质量均一性、生产加工适应性以及防水、防霉变性等方面更超过了天然皮革。随着超纤革技术的发展,超纤革逐步被应用到鞋类、汽车、服装等领域;同时,箱包革、家具革以及杂货用革的用量也在持续稳定增长。但超纤革在做干法镜面时易出现表观折痕严重及压花纹路不良问题,这在很多领域限制了超纤的广泛应用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在之缺失,其主要目的是提供一种压花效果更佳的新型超纤合成革。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采用如下之技术方案:一种新型超纤合成革,其特征在于:包括超纤皮革基层,该超纤皮革基层底面涂覆有一拒水层,且超纤皮革基层上表面则由下至上依次涂覆有湿法 PU 涂层及干法 PU 涂层。

[0005] 本实用新型采用上述技术方案后,其有益效果在于:对超纤皮革基层的底面用辊印的方法涂覆一层拔水剂溶液,再加以烘干形成拒水层;然后在超纤皮革基层的上表面采用湿法工艺形成特殊聚氨酯树脂涂层,在湿法工艺的凝固过程中,由于拒水层降低了超纤皮革基层底面的表面张力,阻遏了毛细效应及压力差的形成,使水难以从底面进入,使涂层中的 DMF 和凝固液中水的交换只在涂层面进行,能有效避免涂层起水泡,保证了质量,并且由于超纤皮革基层湿法 PU 涂层革成品的背面有拒水层,也有一定的防潮能力。综上知其可直接做各种后处理压花,解决了压花纹路不良问题,在做干法镜面时,所增加的平整湿法涂层,改善了原有超纤做镜面产品时易出现的表面不平整和折痕大的问题。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型之实施例的截面图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明:如图 1 所示为本实用新型的一种新型超纤合成革,其特征在于:包括超纤皮革基层 1,该超纤皮革基层 1 底面涂覆有一拒水层 2,且超纤皮革基层 1 上表面则由下至上依次涂覆有湿法 PU 涂层 3 及干法 PU 涂层 4。

[0008] 本实用新型的重点在于,对超纤皮革基层 1 的底面用辊印的方法涂覆一层拔水剂

溶液,再加以烘干形成拒水层 2;然后在超纤皮革基层 1 的上表面用湿法涂层工艺形成聚氨酯树脂涂层,在湿法工艺的凝固过程中,由于拒水层 2 降低了超纤皮革基层 1 底面的表面张力,阻遏了毛细效应及压力差的形成,使水难以从底面进入,使涂层中的 DMF 和凝固液中水的交换只在涂层面进行,能有效避免涂层起水泡,保证了质量,并且由于超纤皮革基层湿法 PU 涂层革成品的背面有拒水层,也有一定的防潮能力。综上知其可直接做各种后处理压花,解决了压花纹路不良问题,在做干法镜面时,所增加的平整湿法涂层,改善了原有超纤做镜面产品时易出现的表面不平整和折痕大的问题。

[0009] 以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

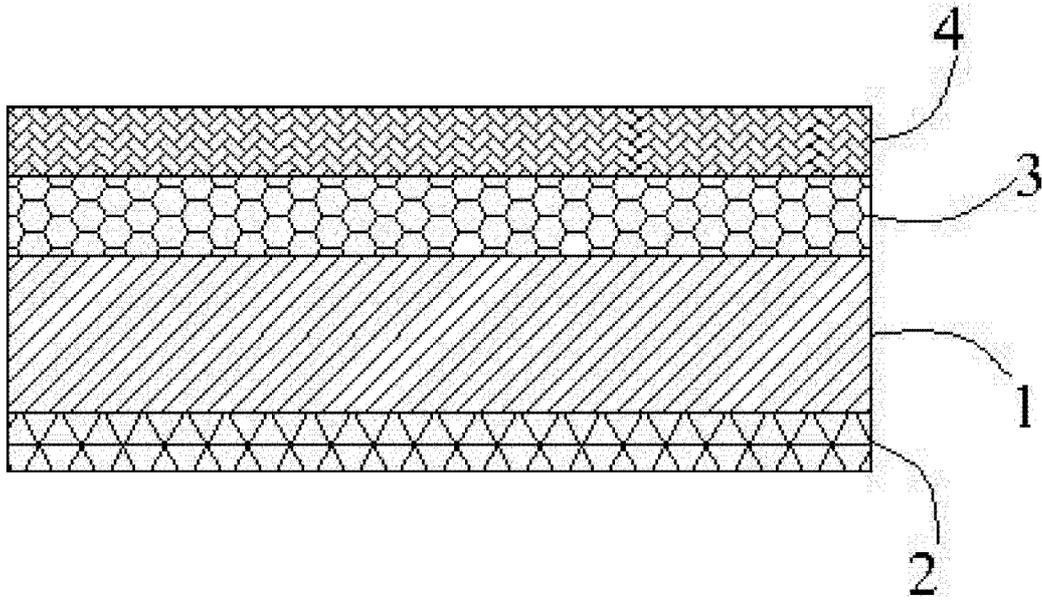


图 1